高等学校化学学报 2006, 27(1) 104-107 DOI: ISSN: 0251-0790 CN: 22-1131/06

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

低介电多孔薄膜的制备及形成机制研究

徐洪耀,王献彪,吴振玉

安徽大学化学化工学院,安徽省绿色高分子材料重点实验室,合肥 230039

摘要:

摘要利用硅烷偶联剂KH-570(γ-甲基丙烯酰氧基甲氧基硅烷)水解缩合生成的多面低聚倍半硅氧烷(POSS)溶胶为模 板剂, 经热解制备低介电多孔薄膜材料. 使用FTIR对材料制备过程及形成机制进行动态研究, 通过 ²⁹Si NMR、 偏仪、 氮气吸脱附曲线和TEM等对材料的介电性质、 孔洞大小和分布情况进行表征. 制备的介电多孔薄膜材料孔 洞分布均匀、 孔径约1 nm, 比表面积为384.1 m^2/g , 介电常数为2.5的低.

关键词: 多孔薄膜: 低介电常数: 旋转涂布

Preparation and Forming Mechanism of Porous Film with Low Dielectric Constant

XU Hong-Yao, WANG Xian-Biao, WU Zhen-Yu

The Key Laboratory of Environment friendly Polymer Materials of Anhui Province, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Anhui University, Hefei 230039, China

Abstract:

AbstractPOSS sol-gel as the porous silica template was prepared by hydrolyzation and condensation of KH-570(γ-methacryloxypropyltrimethoxy silane). Porous film with a low dielectric constant was obtained 上土献彪 by calcination of POSS template. The process and mechanism of film formation were investigated by FTIR and its structure was characterized by 29 Si NMR, Ellipsometr, N₂ adsorption desorption and TEM. The results show that the film possesses uniform pore with about 1 nm size, dielectric constant 2.5, and $S_{het} = 384.1 \text{ m}^2/g$ and the effects of the surface modification reagent and it's concentration on the dielectric property of film were discussed.

Keywords: POSS; Porous film; Low dielectric constant; Rotary coating

收稿日期 2005-01-04 修回日期 网络版发布日期 2006-01-10

DOI:

基金项目:

国家自然科学基金(批准号: 90206014, 50472038)、 教育部"新世纪优秀人才支持计划"(批准号: NCET-04-0588)、 安徽省优秀青年基金(批准号: 04044060)和安徽省高层次优秀人才研究奖励基金(批准号: 2004Z027

通讯作者:徐洪耀(1964年出生), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 从事新型光电功能材料研究. E-mail: xuhongy@mail.hf.ah.cn

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

文章评论

扩展功能

本文信息

Supporting info

PDF(334KB)

[HTML全文]

(\${article.html_WenJianDaXiao}

参考文献[PDF]

参考文献

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 多孔薄膜: 低介电常数: 旋转涂布

本文作者相关文章

▶徐洪耀

▶吴振玉

PubMed

Article by Xu, H. Y.

Article by Wang, X. B.

Article by Wu, Z. Y.

反馈人	邮箱地址	
反馈标题	验证码	1908

Copyright 2008 by 高等学校化学学报